



# 準優秀賞

工学院大学  
高機能デバイス研究室

川口 拓真 殿

反応性スパッタリング法を用いたp型SnO<sub>x</sub>薄膜作製へ向  
けた窒化条件探索

第13回 大学コンソーシアム八王子学生発表会  
におけるあなたの発表は優秀と認められました  
ここにその発表を賞し賞状を贈ります

令和3年12月4日

大学コンソーシアム八王子

会 長 伊藤 慎一郎

